

半導体用高純度ガス事業で SK Inc.と北米協業検討覚書を締結 ～アメリカでの現地生産化の検討を本格開始～

昭和電工株式会社（社長：高橋 秀仁）と韓国の SK Inc.は、6月29日、半導体の製造工程で使われる高純度ガス事業の北米協業検討覚書（MOU）を締結しました。2社共同で北米での半導体用高純度ガス現地生産の検討を始めます。

世界各国の半導体市場が成長するとともに地政学リスクが高まるなか、アメリカ政府は半導体産業の強化と供給網の国内誘致に乗り出しています。これを受けて、大手半導体メーカーによるアメリカでの投資や設備増強が増え、半導体材料の同国内での需要も拡大しています。半導体ウェハーの回路形成（前工程）に使われる高純度ガスも需給がひっ迫し、半導体メーカーからの安定供給の要望が強まっています。一方、当社の半導体用高純度ガス事業は、アジアの生産拠点で生産・充填し、アメリカへ輸送するサプライチェーンを構築しているため、輸送コストアップや、物流ひっ迫時の供給不安といったビジネス上の課題がありました。

これらの課題に対応するため、当社と韓国 SK Inc.の高純度ガス事業の社内独立企業である SK Inc.マテリアルズは、共同で北米での半導体用高純度ガス現地生産の検討を開始しました。半導体用高純度ガスの市場で、エッチングガス^{*1}においてトップシェアを持つ昭和電工と、クリーニングガス^{*2}および成膜ガス^{*3}でトップシェアを持つ SK Inc.マテリアルズが共創し、アメリカビジネスの拡大を狙います。

当社と SK Inc.マテリアルズは、2017年に半導体用高純度ガスの製造・販売を行う合併会社「SK 昭和電工」を設立し、韓国で窒化膜のエッチングガスである CH₃F の生産を行っています。現在、SK 昭和電工は HBr の製造プラントを韓国に建設しており、7月に竣工予定です。

昭和電工グループは「共創型化学会社」として、グローバル社会の持続可能な発展への貢献を目指し、半導体用高純度ガス事業が含まれるエレクトロニクス事業をコア成長事業と位置付けて注力しています。今後も、半導体市場の成長に迅速に対応し、最先端の製品を供給し続けることで、エレクトロニクス事業の成長を実現してまいります。

*1 エッチングガス ウェハー上に電子回路等を形成するため、微細な溝や孔を膜に刻むエッチング工程で使われるガス

*2 クリーニングガス 半導体製造装置内を洗浄するために使われるガス

*3 成膜ガス ウェハー上に薄い酸化膜や窒化膜等を形成するために使われるガス

以上

◆ 本件に関するお問い合わせ先

ブランド・コミュニケーション部 広報グループ 03-5470-3235